

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2003-98672(P2003-98672A)

【公開日】平成15年4月4日(2003.4.4)

【出願番号】特願2001-287112(P2001-287112)

【国際特許分類】

G 03 F	7/039	(2006.01)
C 08 F	20/10	(2006.01)
C 08 F	34/00	(2006.01)
G 03 F	7/004	(2006.01)
H 01 L	21/027	(2006.01)

【F I】

G 03 F	7/039	6 0 1
C 08 F	20/10	
C 08 F	34/00	
G 03 F	7/004	5 0 1
H 01 L	21/30	5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月29日(2005.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、
(B)単環又は多環の脂環炭化水素構造を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液
中での溶解度が増大する樹脂、及び
(C)酸素含有脂肪族第1級アミン、酸素含有脂肪族第2級アミン、および酸素含有脂肪
族第3級アミンからなる群から選ばれた少なくとも1種の塩基性化合物
を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

【請求項2】更に、(C')酸素を含有しない塩基性化合物を含有する請求項1に
記載のポジ型感光性組成物。

【請求項3】更に、(E)水酸基を含有する溶剤と水酸基を含有しない溶剤とを混
合した混合溶剤を含有する請求項1または2に記載のポジ型感光性組成物。

【請求項4】請求項1～3のいずれかに記載のポジ型感光性組成物により膜を形成
し、当該膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。